esp@cenet document view

1/1 ページ

## WAFER SCRIBING APPARATUS AND METHOD

Publication number:

JP8264488

Publication date:

1996-10-11

Inventors

UMEMOTO KAZUNOBU

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H01L21/301; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/301

- european:

Application number:

JP19950062831 19950322

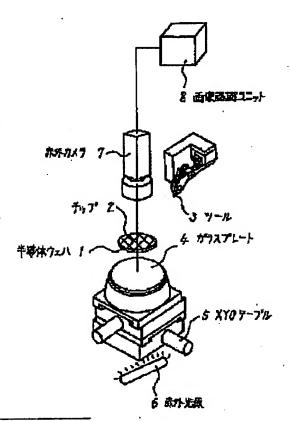
Priority number(s):

JP19950062831 19950322

Report a data error here

### Abstract of JP8264488

PURPOSE: To improve the alignmentaccuracy of scribing line to be provided at the rear surface of a semiconductor wafer. CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 is absorbingly fixed to a glass plate 4 with the rear surface placed upward and the semiconductor wafer 1 is moved within the sight of an infrared camera 7 with an XY&theta table 5. Next, an infrared light source 6 emits the infrared ray to the semiconductor wafer 1 and the infrared camera 7 picks up the transmitting light. Thereby, an image recognition unit 8 picks up a pattern image formed at the surface of the semiconductor wafer 1 and detects a scribe line depending on a mark indicating a dividing line. The semiconductor wafer 1 is aligned by the XY&theta table 5 so that a tool 3 can scribe along the detected line on the semiconductor wafer 1 for the scribing of the rear surface of the semiconductor wafer 1 through movement of the tool 3.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公別番号

## 特開平8-264488

(43)公開日 平成8年(1996)10月11日

C

(51) Int.CL\* HO1L 21/301 錢別記号

庁内整理番号

FΙ HO1L 21/78 技術表示箇所

請求項の数3 OL (全4 頁) 審查請求 有

(21)出願番号

特質平7-62831

(22)出顧日

平成7年(1995) 3月22日

(71)出國人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 梅本 和伸

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (51.2名)

## (54) 【発明の名称】 ウェハスクライブ装置及び方法

#### (57)【荽約】

【目的】 半導体ウェハの裏面に設けるスクライプライ ンの位置精度を向上させる。

【構成】 半導体ウェハ1を裏面が上側となるようにガ ラスプレート4に吸着固定させ、XY8テーブル5によ り赤外カメラフの視野内に半導体ウェハ1を移動させ る。次に赤外光頭6から赤外光を半導体ウェハ1に出射 し、その透過光を赤外カメラフで撮像する。これにより 半導体ウェハ1の表面に形成されたパターン回像を画像 20世ユニット8に取り込み、分割線を示すマークに従っ てスクライブする線を検出する。検出した半導体ウェハ 1上の根に沿ってツール3がスクライブできるようにX Y θ テーブル 5 により半導体ウェハ 1 を位置決めし、ツ ール3を移動させて半導体ウェハ1の裏面をスクライブ FP03-0042-00US

する。

0042-01US 0046-00US 0270-00 US 0278-00 US '06, 10, 03

